PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-163794

(43)Date of publication of application: 16.06.2000

(51)Int.CI.

G01N 13/14 G01N 13/10 G02B 13/00 G11B

(21)Application number: 11-125205

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(22)Date of filing:

30.04.1999

(72)Inventor: KAMIYANAGI KIICHI

(30)Priority

Priority number: 10126528

Priority date: 08.05.1998

Priority country: JP

10268014 22.09.1998

JP

(54) OPTICAL HEAD, DISK DEVICE, AND MANUFACTURE OF OPTICAL HEAD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical head, a disk device, an optical device, and manufacture of the optical head which permit high-density recording of an optical disk, and are miniaturized and improved in data transfer rate.

SOLUTION: When a laser beam 2a is emitted from a semiconductor laser unit 2, the laser beam 2a is shaped into a parallel beam 2b by a collimator lens 3, and is reflected a mirror 4 before converged by an object lens 5, and then made incident on a plane of incidence 6a of a transparent medium for condensing. Converged light 2c made incident on the plane of incidence 6a is refracted through the plane of incidence 6a, and the refracted light 2d is condensed on a plane 6b for condensation, and a light spot 9 is formed, and near field light 10 seeps out of a minute hole 7a in the direction orthogonal to a recording track. The near field light seeping out of the minute hole 7a is made incident to a recording film 8a of a recording medium 8 as propagating light, and this light

makes it possible to record and reproduce on/from the recording film 8a.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Citation

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-163794

(P2000-163794A)(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΊ			テーマコード (参考)
G11B 7/135.		G11B 7/13	35	7 2	H087
				A 5	D119
GOIN 13/14		G01N 37/00)	D	•
13/10				Y	
G02B 13/00		G02B 13/00)		
	審査請求	未請求 請求	項の数79 OL	(全24頁)) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平II-I25205	(71)出願人	000005496		<u> </u>
	•		富士ゼロック	ス株式会社	
(22)出願日	平成11年4月30日(1999.4.30)		東京都港区赤	坂二丁目17番	幹 22号
		(72)発明者	上柳 喜一		
(31)優先権主張番号	特願平10-126528	神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーン			
(32)優先日	平成10年5月8日(1998.5.8)		テクなかい富	士ゼロックス	、株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(74)代理人	100071526		•
(31)優先権主張番号	特願平10-268014		弁理士 平田	忠雄	
(32)優先日	平成10年9月22日(1998.9.22)				

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光ヘッド、ディスク装置、光学素子、および光ヘッドの製造方法

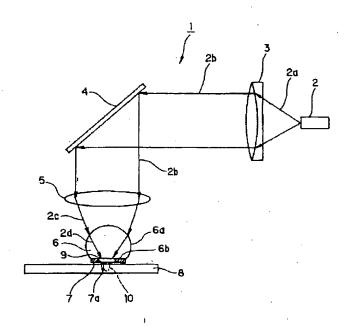
(57)【要約】

(33)優先権主張国

【課題】 光ディスクの高記録密度化が可能となり、小 型化およびデータ転送レートの向上を図った光ヘッド、 ディスク装置、光学素子、および光ヘッドの製造方法を 提供する。

日本(JP)

【解決手段】 半導体レーザ2からレーザビーム2aを 出射すると、そのレーザビーム2aはコリメータレンズ 3によって平行ビーム2bに整形され、ミラー4で反射 された後、対物レンズ5によって収束され、透明集光用 媒体6の入射面6 aに入射する。入射面6 aに入射した 収束光2cは、入射面6aで屈折し、その屈折光2dは 集光面6bに集光し、集光面6bに光スポット9が形成 され、記録トラックの方向に直交する方向のスリット7 aから近接場光10が滲み出す。スリット7aから滲み 出した近接場光10は、記録媒体8の記録層8a中に伝 播光となって入射し、この光によって記録層8aへの記 録および再生が可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】レーザ光を出射するレーザ光出射手段と、 透明集光用媒体を含み、前記レーザ光出射手段からの前 記レーザ光を前記透明集光用媒体の集光面上に集光して 光スポットを形成する光学系と、

前記透明集光用媒体上に設けられ、長辺が前記光スポッ トの径よりも長く、かつ、短辺が前記スポット径よりも 短いスリットが前記光スポットの形成位置に設けられた 遮光体とを備えたことを特徴とする光ヘッド。

【請求項2】レーザ光を出射するレーザ光出射手段と、 前記レーザ光源からの前記レーザ光を集光する集光光学 系と、

前記集光光学系によって集光されたレーザ光によって光 スポットが形成される集光面を有する透明集光用媒体

前記透明集光用媒体上に設けられ、長辺が前記光スポッ トの径よりも長く、かつ、短辺が前記スポット径よりも 短いスリットが前記光スポットの形成位置に設けられた 遮光体とを備えたことを特徴とする光ヘッド。

【請求項3】前記集光光学系は、前記透明集光用媒体と 20 離間した位置に設けられた光学レンズであることを特徴 とする請求項2記載の光ヘッド。

【請求項4】前記集光光学系は、反射体であることを特 徴とする請求項2記載の光ヘッド。

【請求項5】前記反射体は、前記透明集光用媒体表面上 に設けられたことを特徴とする請求項4記載の光ヘッ ۲.

【請求項6】前記透明集光用媒体が、ソリッドイマージ ョンレンズであることを特徴とする請求項2記載の光へ ッド。

【請求項7】前記集光光学系は、対物レンズであり、 前記透明集光用媒体は、球面の一部から構成され、前記 対物レンズによって集光された前記レーザ光が入射され る入射面を有し、前記球面の中心付近を通る軸上に前記 集光面が形成された構成の請求項2記載の光ヘッド。

【請求項8】前記透明集光用媒体は、前記レーザ光が入 射する面が光学的パワーを有することを特徴とする請求 項2記載の光ヘッド。

【請求項9】前記透明集光用媒体が、スーパーソリッド イマージョンレンズであることを特徴とする請求項2記 40 載の光ヘッド。

【請求項10】前記集光光学系は、対物レンズであり、 前記透明集光用媒体は、球面の一部から構成され、前記 対物レンズによって集光された前記レーザ光が入射さ れ、その入射された前記レーザ光を屈折させる入射面を 有し、前記球面の中心からr/n(rは前記球面の半 径、nは前記透明集光用媒体の屈折率)の位置に前記集 光面が形成された構成の請求項2記載の光ヘッド。

【請求項11】前記透明集光用媒体は、前記レーザ光が 入射する面が、前記入射するレーザ光を発散する凹面形 50 状を有し、

前記集光光学系は、少なくとも前記透明集光用媒体の前 記レーザ光の入射位置から前記透明集光用媒体を介して 設けられるとともに前記レーザ光が入射する面で発散さ れた前記レーザ光を集光することを特徴とする請求項2 記載の光ヘッド。

【請求項12】前記集光光学系は、反射膜であり、 前記透明集光用媒体は、前記レーザ光出射手段からの前 記レーザ光が入射する凹球面状の入射面と、前記入射面 の周囲に前記反射膜が形成され、前記入射面に入射し、 前記遮光体で反射したレーザ光を前記反射膜で反射させ て前記集光面に前記光スポットを形成させる非球面状の 反射面とを有する構成の請求項2記載の光ヘッド。

【請求項13】前記集光光学系は、少なくとも前記透明 集光用媒体の前記レーザ光が入射する位置に対し前記透 明集光用媒体を介して設けられ、前記入射したレーザ光 の入射する方向と交差する方向に光路を変化させて前記 透明集光用媒体上に前記光スポットを形成することを特 徴とする請求項2記載の光ヘッド。

【請求項14】前記集光光学系は、反射体であることを 特徴とする請求項13記載の光ヘッド。

【請求項15】前記透明集光用媒体は、前記レーザ光が 入射する面が平面であることを特徴とする請求項13記 載の光ヘッド。

【請求項16】前記透明集光用媒体の前記入射面および 前記集光面は、それぞれ平面からなり、互いに直交する 構成の請求項13記載の光ヘッド。

【請求項17】前記集光光学系は、反射膜であり、 前記透明集光用媒体は、前記レーザ光出射手段からの前 記レーザ光が入射する平面状の入射面と、前記反射膜が 形成され、前記入射面に入射したレーザ光を前記反射膜 で反射させ、前記集光面に前記光スポットを形成させる

【請求項18】前記反射面は、回転放物面の一部を構成 する請求項17記載の光ヘッド。

【請求項19】前記反射面は、平面から構成され、 前記反射膜は、平面状に形成された反射型ホログラムで ある構成の請求項17記載の光ヘッド。

【請求項20】前記反射型ホログラムは、ボリュームホ ログラムにより構成された請求項19記光ヘッド。

【請求項21】前記反射型ホログラムは、凹凸型のバイ ナリーホログラムにより構成された請求項19載の光へ

【請求項22】記録トラック上に情報が記録保持される ディスクから前記情報を記録再生するための光ヘッドに

レーザ光を出射するレーザ光出射手段と、

透明集光用媒体を含み、前記レーザ光出射手段からの前 記レーザ光を前記透明集光用媒体の集光面上に集光して 光スポットを形成する光学系と、

反射面とを有する構成の請求項2記載の光ヘッド。

前記透明集光用媒体上に設けられ、前記記録トラックと 交差する方向が長手方向となるように配置されたスリットが前記光スポットの形成位置に設けられた遮光体とを 備えたことを特徴とする光ヘッド。

【請求項23】前記光学系は、前記透明集光用媒体と離間して配置された対物レンズを備え、前記透明集光用媒体は、球面の一部から構成され、前記対物レンズによって集光された前記レーザ光が入射され、その入射された前記レーザ光を屈折させる入射面を有し、前記球面の中心から r/n (rは前記球面の半径、nは前記透明集光 10用媒体の屈折率)の位置に前記集光面が形成された構成の請求項22記載の光ヘッド。

【請求項24】レーザ光を出射するレーザ光出射手段と、

前記レーザ光を集光するとともに、集光されたレーザ光 によって光スポットが形成される集光面を有する透明集 光用媒体と、

前記透明集光用媒体上に設けられ、長辺が前記光スポットの径よりも長く、かつ、短辺が前記スポット径よりも短いスリットが前記光スポットの形成位置に設けられた 20 遮光体とを備えたことを特徴とする光ヘッド。

【請求項25】前記透明集光用媒体は、前記レーザ光の 入射面が光学的パワーを有することを特徴とする請求項 24記載の光ヘッド。

【請求項26】前記透明集光用媒体は、スーパーソリッドイマージョンレンズであることを特徴とする請求項24記載の光ヘッド。

【請求項27】前記透明集光用媒体は、1より大なる屈 折率を有する構成の請求項1乃至請求項26いずれか1 項記載の光ヘッド。

【請求項28】前記透明集光用媒体は、重フリントガラスで形成されてなることを特徴とする請求項1乃至請求項27いずれか1項記載の光ヘッド。

【請求項29】前記透明集光用媒体は、結晶性材料であることを特徴とする請求項1乃至請求項28いずれか1項記載の光ヘッド。

【請求項30】前記遮光体の前記スリットは、前記レーザ光の波長より小なる幅を有する構成の請求項1乃至29いずれか1項記載記載の光ヘッド。

【請求項31】前記遮光体は、前記レーザ光の波長より 40 か1記載の光ヘッド。 小なる厚さを有する遮光膜である請求項1乃至請求項3 【請求項43】前記 0いずれか1項記載の光ヘッド。 第1の透明媒体およる

【請求項32】前記遮光膜は、前記光ディスク上に形成された前記近接場光スポットの反射光を前記スリット内の他に前記遮光膜の外側を通過させて外部に出力させる外径を有する構成の請求項1記載の光ヘッド。

【請求項33】前記遮光体は、前記透明集光用媒体に埋め込まれた構成の請求項1乃至請求項31いずれか1項記載の光ヘッド。

【請求項34】前記透明集光用媒体は、前記スリットの 50 載の光ヘッド。

内部に位置し、その先端が集光面となる凸部を有することを特徴とする請求項1乃至請求項32いずれか1項記載の光ヘッド。

【請求項35】前記凸部の先端部と、前記遮光体の表面 とがほぼ平坦であることを特徴とする請求項33記載の 光ヘッド。

【請求項36】前記遮光体は、前記透明集光用媒体の前記集光面側からスリットを形成するためのエッチング工程を行って作成されてなる遮光体であることを特徴とする請求項1乃至請求項34いずれか1項記載の光ヘッド。

【請求項37】前記レーザ光出射手段は、単一の前記レーザ光を出射し、

前記遮光体は、前記単一のレーザ光による単一の前記光スポットの形成位置に複数の前記スリットを有する構成の請求項1乃至請求項35いずれか1項記載の光ヘッド。

【請求項38】前記レーザ光出射手段は、複数の前記レ ーザ光を出射し、

前記遮光体は、前記複数のレーザ光による複数の前記光 スポットの形成位置にそれぞれ対応した前記スリットを 有する構成の請求項1乃至請求項36いずれか1項記載 の光ヘッド。

【請求項39】前記透明集光用媒体の前記集光面と前記レーザ光の主光学軸とが、前記スリットにおいて直交する構成の請求項1乃至請求項37いずれか1項記載の光ヘッド。

【請求項40】前記透明集光用媒体は、少なくとも前記スリットの周囲において前記スリットにおける前記レー30 ザ光の主光学軸に垂直な面に対して傾斜したことを特徴とする請求項1乃至請求項38いずれか1項記載の光へッド。

【請求項41】前記遮光膜は、前記光スポットが形成される面に前記レーザ光を吸収する処理が施された構成、あるいは前記レーザ光を吸収する材料で形成された構成の請求項乃至請求項39いずれか1記載の光ヘッド。

【請求項42】前記透明集光用媒体は、少なくとも前記 スリットの周囲において光散乱用の複数の微小の凹凸を 有することを特徴とする請求項1乃至請求項40いずれ か1記載の光へッド

【請求項43】前記透明集光用媒体は、互いに密着した 第1の透明媒体および第2の透明媒体からなり、

前記レーザ光は前記第1の透明媒体に入射し、前記光スポットが形成される前記集光面は前記第2の透明媒体上に位置することを特徴とする請求項1乃至請求項41いずれか1記載の光ヘッド。

【請求項44】前記第2の透明媒体は、ディスクの回転に伴って前記ディスク上を浮上させる浮上スライダの少なくとも一部を構成することを特徴とする請求項42記載の光ヘッド。

【請求項45】前記第2の透明媒体は、前記スリット内 に位置する凸部を有し、前記凸部の先端と前記浮上スラ イダーの前記ディスクに最近接する底面とが、同一平面 上に存在するように形成されてなることを特徴とする請 求項43記載の光ヘッド。

【請求項46】前記第1の透明媒体および前記前記第2 の透明媒体は、ほぼ同一の屈折率を有することを特徴と する請求項42記載の光ヘッド。

【請求項47】前記レーザ光出射手段は、前記レーザ光 を出射する半導体レーザを備えた構成の請求項1乃至請 10 たことを特徴とする請求項57記載のディスク装置。 求項45いずれか1記載の光ヘッド。

【請求項48】前記半導体レーザは、端面発光型半導体 レーザである構成の請求項46記載の光ヘッド。

【請求項49】前記端面発光型半導体レーザは、活性層 が前記透明集光用媒体の前記集光面に垂直となるように 配置された構成の請求項47記載の光ヘッド。

【請求項50】前記端面発光型半導体レーザは、活性層 が前記透明集光用媒体の前記集光面に平行となるように 配置された構成の請求項47記載の光ヘッド。

【請求項51】前記半導体レーザは、面発光型半導体レ 20 ーザである構成の請求項46記載の光ヘッド。

【請求項52】前記レーザ光出射手段と前記透明集光用 媒体との間の前記レーザ光の主光学軸上に設けられ、前 記レーザ光源からの前記レーザ光を平行光に整形するコ リメータレンズとを備えた構成の請求項1乃至請求項5 0いずれか1項記載の光ヘッド。

【請求項53】前記レーザ光出射手段は、前記レーザ光 を出射するレーザ光源と、前記レーザ光源からの前記レ ーザ光を平行光に整形して前記集光光学系に入射させる コリメートレンズとを備えた構成の請求項2記載の光へ 30 ッド。

【請求項54】前記レーザ光出射手段は、前記レーザ光 を出射するレーザ光源と、前記レーザ光源からの前記レ ーザ光を平行光に整形して前記透明集光用媒体の前記入 射面に入射させるコリメートレンズとを備えた構成の請 求項23記載の光ヘッド。

【請求項55】前記レーザ光出射手段は、前記レーザ光 を出射するレーザ光源と、前記レーザ光源を移動させ て、前記光スポットが形成される位置を所定の方向に変 位させる圧電素子とを備えた構成の請求項1乃至請求項 40 53のいずれか1記載の光ヘッド。

【請求項56】前記レーザ光出射手段は、前記レーザ光 を出射するとともに、前記レーザ光の出射位置を移動さ せることにより前記光スポットが形成される位置を所定。 の方向に変位させるレーザ光源を備えた構成の請求項1 乃至請求項54のいずれか記載の光ヘッド。

【請求項57】少なくとも前記レーザ光出射手段および 前記透明集光用媒体は、同一筐体上に固定されてなるこ とを特徴とする請求項1乃至請求項55のいずれか1記 載の光ヘッド。

【請求項58】回転するディスクと、前記ディスク上に 近接場光を照射し、前記ディスクに記録された情報の検 出行うディスク装置において、

請求項1乃至請求項56いずれか1項記載の光ヘッド

前記光ヘッドを駆動する駆動手段とを備えたことを特徴 とするディスク装置。

【請求項59】前記ディスクを前記近接場光で照射する ことにより得られる記録信号を検出する検出手段を備え

【請求項60】前記光ヘッドの少なくとも前記透明集光 用媒体と前記レーザ光出射手設とが設けられた前記浮上 スライダを備えたことを特徴とする請求項57記載のデ ィスク装置。

【請求項61】前記透明集光用媒体は、互いに密着した 第1の透明媒体および第2の透明媒体からなり、前記レ ーザ光は前記第1の透明媒体に入射し、前記光スポット が形成される前記集光面は前記第2の透明媒体上に位置 するとともに、

前記第2の透明媒体は、ディスクの回転に伴って前記デ ィスク上を浮上させる浮上スライダの少なくとも一部を 構成することを特徴とする請求項57記載のディスク装 置。

【請求項62】前記ディスクを前記近接場光で照射する ことにより得られる記録信号を検出するための検出手段 を前記浮上スライダ上に設けたこと特徴とする請求項5 7乃至60いずれか1項記載のディスク装置。

【請求項63】前記ディスクは、凹凸状のピット列によ り情報が記録された再生専用媒体である構成の請求項5 7記載のディスク装置。

【請求項64】前記ディスクは、光磁気記録媒体である 構成の請求項57記載のディスク装置。

【請求項65】前記ディスクは、光相変化記録媒体であ る構成の請求項57記載のディスク装置。

【請求項66】前記ディスクは、色素の光吸収により凹 凸ピットを形成する追記型記録媒体である構成の請求項 57記載のディスク装置。

【請求項67】前記ディスクを前記近接場光で照射する ことにより得られる記録信号を検出するための検出手段

前記遮光体は、前記ディスク上に照射形成された前記近 接場光の反射光を前記スリット内の他に前記遮光体の外 側を通過させて前記光検出手段に入力させる形状を有す る構成の請求項57記載のディスク装置。

【請求項68】前記集光光学系は、反射膜であり、 前記透明集光用媒体は、前記レーザ光出射手段からの前 記レーザ光が入射する凹球面状の入射面と、前記入射面 の周囲に前記反射膜が形成され、前記入射面に入射し、 前記遮光体で反射したレーザ光を前記反射膜で反射させ 50 て前記集光面に前記光スポットを形成させる非球面状の

反射面とを有する構成の請求項57記載のディスク装 置。

【請求項69】同軸上に所定の間隔を有して配置された回転する複数のディスクと、前記複数のディスク上に近接場光スポットを形成し、前記ディスクに記録された情報の検出を行うディスク装置において、

請求項1乃至請求項56いずれか1項記載の複数の光へッドと、

前記ディスクを前記近接場光スポットで照射することにより得られる記録信号を検出する検出手段とを備えたこ 10とを特徴とするディスク装置。

【請求項70】前記レーザ光出射手段は、

前記レーザ光を出射する半導体レーザと、

前記半導体レーザを移動させて前記光スポットが形成される位置を所定のトラッキング方向に変位させる圧電素子と、

少なくとも前記半導体レーザ、前記圧電素子、前記集光 手段、前記透明集光用媒体および前記遮光膜を一体とし て前記所定のトラッキング方向に移動する移動手段と、 低周波域のトラッキング誤差信号に基づいて前記移動手 20 段を駆動し、高周波域のトラッキング誤差信号に基づい て前記圧電素子を駆動する駆動手設とを備えた構成の請 求項57記載のディスク装置。

【請求項71】前記半導体レーザは、前記レーザ光を出射する先端付近に設けられ、電流が分割して、あるいは交互に印加されることにより、前記光スポットが形成される位置を前記所定のトラッキング方向に変位させる一対の電極端子を備えたビーム走査型半導体レーザである構成の請求項69記載のディスク装置。

【請求項72】前記集光手段、前記透明集光用媒体およ 30 び前記遮光膜は、光ヘッドとして前記ディスク上に一体的に設けられ、

前記レーザ光出射手股および前記光検出手段は、前記装置本体側に設けられ、前記光ヘッドと前記レーザ光出射手股および前記光検出手段とは、光ファイバによって光学的に接続された構成の請求項57記載のディスク装置。

【請求項73】入射したレーザ光によって光スポットが 形成される集光面を有する透明集光用媒体を準備し、 前記透明集光用媒体に長辺が前記光スポットの径よりも 40 長く、かつ、短辺が前記スポット径よりも短い形状のホ トレジストを形成し、

前記透明集光用媒体の前記ホトレジストの存在しない領域を前記レーザ光の波長以下の所定の深さでエッチングによって除去することにより凹部を形成し、

前記凹部に遮光材料を堆積させて前記形状のスリットを 有した遮光体を形成することを特徴とする光ヘッドの製 造方法。

【請求項74】前記ホトレジストの形成する段階は、前 ーザ191からのレーザ光191aを平行ビーム191 記透明集光用媒体の外縁に前記遮光体の形状を決定する 50 bに整形するカプリングレンズ192と、入射端193

ホトレジストを形成する段階を含む構成の請求項72記載の光ヘッドの製造方法。

【請求項75】前記凹部を形成する段階は、前記凹部の 座面に光散乱用の複数の微小の凹凸を形成する段階を含む構成の請求項72記載の光ヘッドの製造方法。

【請求項76】前記凹部を形成する段階は、前記凹部の 座面を傾斜面に形成する段階を含む構成の請求項72記 載の光ヘッドの製造方法。

【請求項77】請求項1乃至請求項56のいずれか1項 記載の光ヘッドの製造方法において、

前記遮光体を形成する工程中に、前記透明集光用媒体の 前記集光面側からエッチング工程を施す工程を含むこと を特徴とする光ヘッドの製造方法。

【請求項78】光ヘッドに用いる光学素子において、 レーザ光が入射する入射面と、

前記レーザ光が集光してなる光スポットが形成され、長 辺が前記光スポットの径よりも長く、かつ、短辺が前記 スポット径よりも短い凸条を備えたことを特徴とする光 学素子。

0 【請求項79】前記凸条は、その周縁に遮光体を備えた ことを特徴とする請求項77記載の光学素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、近接場光を利用した光へッド、ディスク装置、光学素子、および光へッドの製造方法に関し、特に、光ディスクの高記録密度化が可能となり、小型化およびデータ転送レートの向上を図った光へッド、ディスク装置、光学素子、および光へッドの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】光ディスク装置においては、光ディスクはコンパクトディスク(CD)からディジタルビデオディスク(DVD)へと高密度・大容量化が進められているが、コンピュータの高性能化やディスプレイ装置の高精細化に伴い、ますます大容量化が求められている。

【0003】光ディスクの記録密度は、基本的には記録媒体上に形成される光スポットの径で抑えられる。近年、光スポット径を小さくする技術として顕微鏡の近接場光の技術が光記録に応用されている。この近接場光を用いた従来の光ディスク装置としては、例えば、文献(Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 35(1996)P. 443)および米国特許公報USP5497359に記載されたものがある。

【0004】図23(a),(b)は、文献(Jpn. J. Appl. Phys., VOL. 35(1996) P. 443)に記載された光ディスク装置を示す。この光ディスク装置190は、図23(a)に示すように、レーザ光191aを出射する半導体レーザ191と、半導体レーザ191からのレーザ光191aを平行ビーム191bに整形するカプリングレンズ192と、入射端193

aから出射端193bに向かって細くなるようにテーパ 状に研磨された光ファイバ193を有し、カプリングレ ンズ192からの平行ビーム191bを入射端193a から導入するプローブ194と、光ファイバ193の出 射端193bから漏れ出す近接場光191cによろて記 録される記録媒体195とを有する。

【0005】記録媒体195は、相変化媒体のGeSb Teからなる記録層195aを有し、近接場光191c が入射されることによって加熱され、結晶/アモルファ ス間の相変化を引き起こし、両者間の反射率変化を用い 10 て記録されるものである。

【0006】光ファイバ193は、入射端193aが直。 径10 μm、出射端193bが直径50 nmに加工さ れ、クラッド194aを介してアルミニウム等の金属膜 194bでコーティングされており、出射端193b以 外への光の漏れ出しを防いでいる。近接場光191cの 直径は、出射端193bの直径と同程度となるため、数 +Gbits/inch² の高記録密度が可能となる。

【0007】再生には、図23(b) に示すように、記録 時と同様の光ヘッドを用いて、相変化を引き起こさない 20 程度の低パワーの近接場光191cを記録層195aに 照射し、そこからの反射光191dを集光レンズ196 により光電子増倍管(以下「フォトマル」と略称す る。) 197に集光して検出することにより行う。

【0008】図24は、米国特許公報USP54973 59に記載された光ディスク装置の光ヘッドを示す。こ の光ヘッド50は、平行光51を集光する対物レンズ5

 $D_{1/2} = k \lambda / (n \cdot NAi) = k \lambda / (n^2 \cdot NAo)$

ここに、k:光ビームの強度分布に依存する比例常数 (通常0.5程度)

λ:光ビームの波長

n:SIL54の屈折率

NAi:SIL54内部での開口数

NAo:SIL54への入射光の開口数

平行光51が光路上で吸収されることなく光スポット5 5として集光されるため、高い光利用効率が得られる。 この結果、比較的低出力の光源を用いることができ、ホ トマルを用いなくても反射光の検出を行うことができ る。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の光ディ スク装置190によると、記録媒体上に数十ヵm程度の 微小の光スポットを形成できるが、光ファイバ193は テーパ状であるため、光ファイバ193に入射したレー ザの一部が内部に吸収され、光利用効率が1/1000 以下と低くなるという問題がある。このため、反射光1 91 dの検出にフォトマル197を使用せざるを得ず、 光ヘッド部が大型で高価となる。また、フォトマル19 7の応答速度が遅く、光ヘッド部が重いため、高速のト ラッキングができない。従って、光ディスクを高速回転 50

2と、この対物レンズ52からの収束光53に対して底 面54 aが直交するように配置された裁底球状のSIL (Solid Immersion Lens) 54とを有する。平行光51 を対物レンズ52によって収束させ、その収東光53を 球面状の入射面54bに入射させると、収束光53は入 射面54bで屈折して底面54aに集光し、底面54a に光スポット55が形成される。SIL54内部では、 光の波長はSIL54の屈折率に逆比例して短くなるた め、光スポット55もそれに比例して小さくなる。この 光スポット55に集光された光の大半は入射面54bに 向かって全反射されるが、その一部は光スポット55か らSIL54の外部に近接場光57として滲み出す。底 面54aから光の波長より十分小さい距離にSIL54 と同程度の屈折率を有する記録媒体56を配置すると、 近接場光57が記録媒体56とカップルして記録媒体5 6内を伝播する伝播光となる。この伝播光によって、記 録媒体56に情報が記録される。

【0009】 SIL54を平行光51が半球面54bの 中心54cからr/n(rはSILの半径)の位置に集 光するような構成にすることにより(これをSuper SIL構造と称する。)、SIL54による球面収差 が小さく、かつ、SIL54内部での開口数を上げるこ とができ、さらに光スポット55の微小化を図ることが 可能になる。すなわち、光スポット55の径(光強度が 1/2となるところのスポット径) D_{1/2} は、次式 (1)のように微小化される。

させることができないので転送レートが低い等の多く問 題があり、実用化には多くの改良を必要とする。

【0011】図25は、図24に示す従来の光ヘッド5 0 の問題点を説明するための図で、鈴木氏がAsia-Pasific Data Storage Conf erence (Taiwan, '97.7.) c OC -1において解析したものであり、SIL54の屈折率 nとNAoの関係を示す。SIL54への入射光のN A、すなわち入射角 θ の最大値 θ maxとSIL54の 屈折率nには相反関係があり、両者を独立に大きくでき る訳ではない。同図から分かるように、SIL54の屈 40 折率 n を上げて行くと、入射光のNAoの採り得る最大 値NAomaxは次第に小さくなる。これは、最大値N Aomax以上にNAoが増加して入射角がさらに大き くなると、その光はSIL54を通らずに直接記録媒体 56に入射するため、記録媒体56の位置における光ス ポット55が却って広がるからである。例えば、屈折率 n=2のとき、NAomaxは0.44であり、両者の 積n·NAomaxは、両者のどのような組合せでも 0.8~0.9までである。これは理論限界であり、実 際にはそれよりもさらに小さな値(0.7~0.8)と なる。

【0012】このSuper SILによる集光実験については、B. D. Terris他がAppl. Phys. Lett., Vol. 68, ('96), P. 14 1. において報告している。この報告によると、屈折率n=1. 83のSuperSILを対物レンズと記録媒体の間に置き、波長0. 83 μ mのレーザ光を集光することにより0. 317 μ mの光スポット径を得ている。すなわち、D $_{1/2}=\lambda/2$. 3相当の集光を達成しているが、この場合のNAは0. 4、n・NAmaxは0. 73程度である。また、この系を用いて従来の数倍程度 10の記録密度0. 38×Gbits/cm² の可能性を検証している。

【0014】図26は、文献「日経エレクトロニクス (1998.6.15) (No.718)」に示された 光ヘッドを示す。この光ヘッドは、SIM (Solid

Immersion Mirror)型と称せられて いるものであり、平行レーザビーム2bが入射する凹球 面状の入射面101a、入射面101aに対向する位置 に設けられた集光面101b、集光面101bの周囲に 設けられた平面状反射面101c、および入射面101 aの周囲に形成された非球面状反射面101dを有する 透明集光用媒体101と、平面状反射面101cの表面 に形成された平面状反射膜102と、非球面状反射面1 01 dの表面に形成された非球面状反射膜103とを有 する。このように構成された光ヘッドにおいて、平行レ ーザピーム2 bが透明集光用媒体101の入射面101 aに入射すると、入射面101aに入射した平行レーザ ビーム2bは、入射面101aで拡散され、その拡散光 2 dは、平面状反射膜102で反射し、その反射光2 e は、非球面状反射膜103でさらに反射して集光面10 1 b に集光し、集光面101 b に光スポット9が形成さ れる。集光面101bから滲み出す近接場光10によっ て記録媒体8の記録層8aへの記録および読み出しが可 能になる。この透明集光用媒体101の平面状反射面1 01 c の開口数NAは、0.8程度、透明集光用媒体1 01の屈折率は1.83であり、透明集光用媒体101 内部でのNAは約1.5が可能になる。

【0015】この光ヘッドによると、実際に得られたスポット径は、 $0.35\sim0.39\mu$ mと大きく、透明集光用媒体の集光面上に形成されるスポット径の微小化に限界があるため、高記録密度化が図れないという問題が 50

ある。 【0016】従って 本発明の日

【0016】従って、本発明の目的は、光ディスクの高記録密度化が可能となり、小型化およびデータ転送レートの向上を図った光ヘッド、ディスク装置および光ヘッドの製造方法を提供することにある。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するため、レーザ光を出射するレーザ光出射手段と、 透明集光用媒体を含み、前記レーザ光出射手段からの前 記レーザ光を前記透明集光用媒体の集光面上に集光して 光スポットを形成する光学系と、前記透明集光用媒体上 に設けられ、長辺が前記光スポットの径よりも長く、か つ、短辺が前記スポット径よりも短いスリットが前記光 スポットの形成位置に設けられた遮光体とを備えたこと を特徴とする光ヘッドを提供する。本発明は、上記目的 を達成するため、レーザ光を出射するレーザ光出射手段 と、前記レーザ光源からの前記レーザ光を集光する集光 光学系と、前記集光光学系によって集光されたレーザ光 によって光スポットが形成される集光面を有する透明集 光用媒体と、前記透明集光用媒体上に設けられ、長辺が 前記光スポットの径よりも長く、かつ、短辺が前記スポ ット径よりも短いスリットが前記光スポットの形成位置 に設けられた遮光体とを備えたことを特徴とする光ヘッ ドを提供する。本発明は、上記目的を達成するため、記 録トラック上に情報が記録保持されるディスクから前記 情報を記録再生するための光ヘッドにおいて、レーザ光 を出射するレーザ光出射手段と、透明集光用媒体を含 み、前記レーザ光出射手段からの前記レーザ光を前記透 明集光用媒体の集光面上に集光して光スポットを形成す る光学系と、前記透明集光用媒体上に設けられ、前記記 録トラックと交差する方向が長手方向となるように配置 されたスリットが前記光スポットの形成位置に設けられ た遮光体とを備えたことを特徴とする光ヘッドを提供す る。本発明は、上記目的を達成するため、レーザ光を出 射するレーザ光出射手段と、前記レーザ光を集光すると ともに、集光されたレーザ光によって光スポットが形成 される集光面を有する透明集光用媒体と、前記透明集光 用媒体上に設けられ、長辺が前記光スポットの径よりも 長く、かつ、短辺が前記スポット径よりも短いスリット が前記光スポットの形成位置に設けられた遮光体とを備 えたことを特徴とする光ヘッドを提供する。本発明は、 上記目的を達成するため、回転するディスクと、前記デ ィスク上に近接場光を照射し、前記ディスクに記録され た情報の検出行うディスク装置において、請求項1乃至 請求項56いずれか1項記載の光ヘッドと、前記光ヘッ ドを駆動する駆動手段とを備えたことを特徴とするディ スク装置を提供する。本発明は、上記目的を達成するた め、同軸上に所定の間隔を有して配置された回転する複 数のディスクと、前記複数のディスク上に近接場光スポ ットを形成し、前記ディスクに記録された情報の検出を

行うディスク装置において、請求項1乃至請求項56い ずれか1項記載の複数の光ヘッドと、前記ディスクを前 記近接場光スポットで照射することにより得られる記録 信号を検出する検出手段とを備えたことを特徴とするデ ィスク装置を提供する。本発明は、上記目的を達成する ため、入射したレーザ光によって光スポットが形成され る集光面を有する透明集光用媒体を準備し、前記透明集 光用媒体に長辺が前記光スポットの径よりも長く、か つ、短辺が前記スポット径よりも短い形状のホトレジス トを形成し、前記透明集光用媒体の前記ホトレジストの 10 存在しない領域を前記レーザ光の波長以下の所定の深さ でエッチングによって除去することにより凹部を形成 し、前記凹部に遮光材料を堆積させて前記形状のスリッ トを有した遮光体を形成することを特徴とする光ヘッド の製造方法を提供する。本発明は、上記目的を達成する ため、光ヘッドに用いる光学素子において、レーザ光が 入射する入射面と、前記レーザ光が集光してなる光スポ ットが形成され、長手方向の長さが前記光スポットの径 より大きく、その幅が前記スポット径より小なる凸条を 備えたことを特徴とする光学素子を提供する。

[0018]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1の実施の形 態に係る光ヘッドの主要部を示す。この光ヘッド1は、 レーザビーム2aを出射する半導体レーザ2と、半導体 レーザ2からのレーザビーム2aを平行ビーム2bに整 形するコリメータレンズ3と、コリメータレンズ3から の平行ビーム2bを垂直方向に反射するミラー4と、ミ ラー4で反射した平行ビーム2bを収束さぜる対物レン ズ5と、対物レンズ5により収束された光2cが入射 し、集光面6 bに光スポット9を形成する透明集光用媒 30 体6と、透明集光用媒体6の集光面6bの表面に被着形 成されたスリット7aを有する遮光膜7とを有する。

【0019】半導体レーザ2は、市販で最も短波長の赤 色レーザ (630 nm) や現在開発中のAlGalnN 系の青色レーザ(410nm)を用いることができる。 青色レーザ(410 nm)を用いることにより、光スポ ット径を0. 15 μm以下にすることができ、スリット 7 aへ入射する光の割合を増すことができる。

【0020】図2(a) は、透明集光用媒体6および遮光 膜7を示し、図2(b)は、その底面図である。

 $D_{i/i} = k \lambda / (n \cdot NA i) = k \lambda / (n^i \cdot NA o)$

ここに、NAi:透明集光用媒体6内部での開口数 NAo:透明集光用媒体6への入射光の開口数 - 光スポット9は、式(1)に示すように、透明集光用媒・ 体6の屈折率nに逆比例して微小化され、球面収差の小 さな集光が可能となる。しかし、収束光2cの取り得る 入射角 θ 、すなわち開口数NAoと屈折率nには相反関

【0021】透明集光用媒体6は、重フリントガラス (屈折率1.91) や硫化カドミウムCdS (屈折率 2. 5), 閃亜鉛鉱 Z n S (屈折率 2. 37) 等の結晶 性材料を用いることができ、また、屈折率は1より大き れば上限はなく、さらに高い屈折率の材料を用いること もできる。本実施の形態では、屈折率1.91の重フリ ントガラスを用いた。結晶性材料を用いることにより、 光スポット径を重フリントガラスより2割以上縮小でき る。また、透明集光用媒体6は、図2(a) に示すよう に、球面状の入射面 6 a に入射した対物レンズ 5 からの 収束光2cを入射面6aで屈折させ、その屈折光2dを 底面の集光面6 bに集光させて光スポット9が形成され るように裁底球状 (Super SIL構造) を有して いる。

【0022】 遮光膜7は、遮光材料としてのチタン (T i)からなり、レーザ光の波長より小なる厚さ(例えば 10 nm)を有し、光スポット9に対応する位置にトラ ック方向Xに直交する方向Yのスリット7aを形成し、 光スポット9から外部へ直接出射する光を遮断し、か 20 つ、スリット7aを介して近接場光10を形成するもの である。スリット7aの幅をW、長さをL、光スポット 9 の直径をD_{1/1} とすると、W, LとD_{1/1} の関係が、 $W < D_{1/2}$ 、かつ、L>D_{1/2}

となるように設定している。これにより、長さ約 D:/: 、幅Wの近接場光10が形成される。本実施の形 態では、幅Wを光スポット9の径Dの数分の1程度以 下、すなわち、レーザ光の波長の1/10程度(例えば 50 nm) にしている。なお、スリット幅Wは、光ディ スクの高記録密度化技術およびスリット形成技術の進展 に応じて50nmより小さくしてもよい。また、遮光膜 7は、光スポット9が形成される側の面にレーザ光を吸 収する処理(例えば黒色処理)が施されていてもよく、 レーザ光を吸収する材料で形成されていてもよい。これ により遮光膜で反射したレーザ光によるS/N比の低下 を防げる。

【0023】光スポット9のスポット径D_{1/2}は、球面 の中心6 cから r/n (r、nはそれぞれ透明集光用媒 体6の半径と屈折率)の位置に集光させる場合、従来例 で説明したように、次式(1)で表される。

... (1)

係があり、両者を独立に大きくできる訳ではない。屈折 率nとNAの最大値との積は約0.88であり、光線の けられを考慮すると実際には0.8程度以下となる。従 って、最小光スポット径D_{1/1} minは次式(2)のよ

 $D_{1/2} m i n = k \lambda / (0.8n) = 0.6 \lambda / n$ (k=0.5の時)

... (2)

従って、透明集光用媒体6として非結晶としては最も大 50 きな屈折率を有する重フリントガラス (屈折率=1..9

1)を用い、半導体レーザ 2 に赤色レーザ(波長 6 3 0 nm)を使用した場合、最小光スポット径 $D_{i/i}$ m i n は 0 . 2 0 μ m 2 α の。また、青色レーザ(4 0 α nm)用いた場合は、最小光スポット径 $D_{i/i}$ m i n は約 0 . 1 3 μ m 2 α の。また、それらの光スポット 9 は、ほぼガウス型の強度の広がり分布を有する。

【0024】スリット7aの幅Wはレーザ波長に比べて小さいため、このスリット7aからは伝搬光はほとんど出射せず、トラック方向Xにはスリット7aの幅Wと同程度、垂直方向にはその数倍の大きさの近接場光10が10波長と同程度の近接の距離にまで滲み出している。この近接場光10に誘電体、具体的には、記録媒体8を近接配置することにより、近接場光10が記録媒体8の記録層8a中に伝播光となって入射し、この光によって記録層8aへの記録および読み出しが可能になる。この伝播光の光量は、次式(3)で近似される。

【数1】

 $I = 2I_0 \times \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)/\omega^2} dx \cdot dy \qquad \cdots \qquad (3)$

ここに、 Io: レーザの全パワー

ω : 集光面 6 b での光スポット 9 の半径

a :スリット7aの半幅

すなわち、赤色レーザの場合、スリット7aを通過するレーザ光の光量は光スポット9の全パワーの約20%、青色光の場合は30%以上となり、従来の光ファイバを使用した場合の100倍以上に集光効率を改善することができる。

【0025】図3(a) ~(d) は、遮光膜7の被着方法お よびスリット7aの形成方法に関わる一形態を示す。ま ず、裁底球状の透明集光用媒体6の底面6dに電子ビー ム露光用のフォトレジスト膜70を塗布し、スリット7 aに対応する部分70a、および遮光膜7の周囲に対応 する保護用の部分70bを残すように電子ビームにより 露光し(図3(a))、現像の後、底面6dをドライエッ チングにより約100 Å 異方性にエッチングし、凸部6 f および遮光膜の被着面 6 g を形成する (図 3 (b))。 エッチングガスとしてはCF4系のガスを使用する。次 に、全面に遮光膜用のTi膜71をスパッタリングによ り約100Å被着した後(図3(c))、フォトレジスト 膜70(70a,70b)を溶解することにより、スリ ット7aの部分70aおよび遮光膜7の保護用の部分7 0 bのT i 膜 7 1をリフトオフする (図 3(d))。この ようにしてスリット7aを有する遮光膜7が形成され る。なお、遮光膜7は、遮光性、およびガラスとの優れ た被着性を有する膜であれば、Ti膜以外の他の膜でも よい。なお、本形態の方法のようにその内部に透明集光 用媒体の凸部 6 f が存在するようにスリット7 a を形成 すると、単に遮光膜7にスリットを形成してその内部を 空気層とする場合に対して、凸部6 f から記録媒体間の エアギャップが小さくなるため、近接場光の伝播効率が 50

向上する。遮光膜7 に対して凸部6 f の先端は突出し てもよいし、さらに、図3に示されているように、遮光 膜7と、スリット7a内に位置する透明集光用媒体の凸 部6fとを近接場光の出射側から見て平坦になるよう形 成すると、近接場光の広がりを抑えることができて、高 密度記録により適する。ところで、本形態のように透明 集光用媒体に凸部 6 f を設ける場合は、凸部の先端が集 光面6 bに対応するので、集光面6 b上に光スポットを 形成するとは、光スポットの焦点深度内に凸部6 f の先 端が位置することを意味する。なお、本形態のように、 遮光膜の厚みが十分小さいときには、凸部の先端と遮光 膜の被着面6gはともに光スポットの焦点深度内に位置 する場合が多いから、スポット形成位置を凸部の先端と するか被着面6gとするかは実際には問題となることは 少ない。また、スリット7aを形成する工程中にエッチ ング工程を含む場合に、透明集光用媒体の集光面6 b 側 からエッチングを行うと、通常エッチングを施す面側か ら内部にいくにつれてエッチング量が少なくなるため、 スリット7aに対応する凸部には適度な傾斜が形成され る(図示せず。)この周囲に遮光膜7が形成されると、 遮光膜はスリット7 aにおいて、近接場光の伝播方向に つれて穴が狭まるテーパー形状となるので、近接場光の 集光効果を高めることができる。

【0026】次に、上記第1の実施の形態に係る光ヘッ ド1の動作を説明する。半導体レーザ2からレーザビー ム2aを出射すると、そのレーザビーム2aはコリメー タレンズ3によって平行ビーム2bに整形され、ミラー 4で反射された後、対物レンズ5によって収束され、透 明集光用媒体6の入射面6 aに入射する。入射面6に入 射した収束光2cは、入射面6aで屈折し、その屈折光 2 dは集光面6 bに集光し、集光面6 bに光スポット9 が形成され、スリット7aから近接場光10が滲み出 す。スリット7aから滲み出した近接場光f0は、記録 媒体8の記録層8a中に伝播光となって入射し、この光 によって記録層8aへの記録および再生が可能となる。 【0027】上記第1の実施の形態に係る光ヘッド1に よれば、集光面6 bに形成された光スポット9から滲み 出す近接場光10を遮光膜7に形成したトラック方向X に直交する方向Yのスリット7aによって絞っているの で、従来のSuper SILを用いた場合と比較し て、近接場光10のトラック方向Xの幅を数分の1に小 さくできるので、トラック方向Xの記録密度を数倍に増 大させることができる。また、近接場光10のトラック 方向Xに直交する方向Yの長さは、スポット径Div,に よって決まり、スポット径D_{1/2} を微小化できたことか ら、トラックピッチも増大させることができる。また、 近接場光10をレーザビーム2aの波長より小さい幅の スリット7aで絞ってもスリット7aからの近接場光の 中心光強度はあまり低下しないため、高い光利用効率が 得られる。従って、数ミリワットの比較的低出力の半導

体レーザ2が光源として使用できる。また、記録媒体8 からの反射光もスリット7aからの伝播光に比例して増 大するため、再生光の検出に従来光ディスクメモリに常 用されているSi光検出器が使用でき、ホトマルを使用 しなくて済み、光ヘッド1が小型・軽量化できるととも に、高速度の読み出しが可能となる。また、近接場光1 0のトラック方向Xの幅はスリット幅Wで規定され、集 光面6bでのスポット径D_{1/2} には依存しないため、対 物レンズ5の収差や温度変化によるスポット径の変動の 影響を受け難く、信頼性の高い光ヘッドを提供できる。 【0028】図4(a), (b) は、遮光膜7の変形例を示 す。遮光膜7は、図4(a) に示すように、透明集光用媒 体6の底面6dのエッチング時に、底面6dを傾ける等 の操作により被エッチング面を入射光に対して傾斜さ せ、凸型あるいは凹型の円錐面状にしてもよい。また、 図4(b) に示すように、透明集光用媒体6の底面6dの エッチング時に、比較的大電流で高速にエッチングする 等の操作によりエッチング面に細かい凹凸を形成しても よい。遮光膜7の表面7bの反射率が高いと、遮光膜7 で反射した光強度が、スリット7aから戻る信号光に比 20 べて強くなり、信号処理時の前段増幅の増幅率を大きく

 $D_{1/1}=k\,\lambda/(n\cdot NAo)$ ここに、NAo: SIL型の透明集光用媒体 6への入射光の開口数

【0030】上記第2の実施の形態に係る光ヘッド1によれば、第1の実施の形態と同様に、近接場光10の幅はスリット7aの幅で決まり、光スポット9の直径に依存しないので、収差や位置ずれ等の影響は少ないため、NAoは0.8と従来のSILを用いた光ヘッドに比べて比較的大きくでき、第1の実施の形態のSuperS30IL構造と同等の集光が可能となる。すなわち、赤色レーザ(波長630nm)と青色レーザ(400nm)を用いた場合、それぞれ最小光スポット径として 0.2μ m、 0.13μ mが得られ、スリット7aから滲み出す近接場光10の光量すなわち光利用効率は第1の実施の形態と同程度にできる。

【0031】図6(a) は、本発明の第3の実施の形態に 係る光ヘッドの主要部を示し、同図(b) は、その底面図 を示す。この光ヘッド1は、レーザビーム2aを出射す る半導体レーザ2と、半導体レーザ2からのレーザビー 40

$$y' = 4 p x$$

また、回転放物面を用いて透明集光用媒体6の内部で集 光する場合、原理的に無収差の集光が可能であり(光 学:久保田広、岩波書店、P. 283)、単一の集光性 の反射体で光スポット9を集光することが可能になる。 また、この方式では、透明集光用媒体6の屈折率と反射

$$D_{1/2} = k \lambda / (n \cdot NAr)$$

ここに、NAr: 反射面 6e の反射光の開口数回転放物面の焦点位置のp をp=0. 125 mm とし、回転放物面の上端を(x, y) = (2 mm、1 mm)とすると、

取れなくなるため、S/Nが低下する。一方、遮光膜7での吸収率が高いと、遮光膜7の光スポット9が照射された部分の温度が上昇し、この熱が記録に影響を与えるため好ましくない。そこで、図4(a),(b)に示すような構造にすることにより、反射光2eが対物レンズ5に戻る量が減少し、S/Nを向上させることができる。一方、スリット7aを通過する反射光は、入射光2c、2dと同じ経路をたどり、光検出器(図略)に入射する。これにより、光検出器に入る迷光の割合を減らすことができるため、DC型の前置増幅器の増幅率をあげることができ、S/Nを改善することが可能となる。

【0029】図5は、本発明の第2の実施の形態に係る 光ヘッドの主要部を示す。この光ヘッド1は、透明集光 用媒体6を半球状(SIL型)にしたものであり、他は 第1の実施の形態と同様に構成されている。透明集光用 媒体6の入射面6aに入射した収束光2cは、球面の中 心に集光する。この場合、収束光2cは入射面6aにお いて屈折しないため、透明集光用媒体6中での開口数N Aは、対物レンズ5の出射時のNAと変わらず、屈折に よってNAを増大することはできない。従って、この場 合の光スポット径は次式(4)のようになる。

... (4)

ム2 aを平行ビーム2 bに整形するコリメータレンズ3 と、コリメータレンズ3からの平行ビーム2 bを集光し、集光面6 bに光スポット9を形成する透明集光用媒体6 を、透明集光用媒体6 の反射面6 e の表面に被着形成された反射膜11と、透明集光用媒体6 の集光面6 b の表面に被着形成された幅50 nmのスリット7 aを有する遮光膜7とを有する。スリット7 aは、同図(b) に示すように、長手方向がトラック方向Xに直交する方向Yとなるように形成される。

【0032】透明集光用媒体 6 は、例えば、重フリントガラス(屈折率 1. 91)からなり、平行ビーム 2 bが入射する入射面 6 a と、入射面 6 a に入射した平行ビーム 2 b を反射させる反射面 6 e と、光スポット 9 が形成される集光面 6 b とを有する。反射面 6 e は、回転放物面の一部を用いている。回転放物面の断面(6 e)の主軸を x 軸に、垂直軸を y 軸に採り、焦点位置を(p,0)とすると、断面(6 e)は、次の式(5)で表される。

... (5)

面6 e による集光光の開口数NAに限定がなく、屈折率が高い場合でも、NAは1に近い値を採り得る。従って、この場合の光スポット径は次式(6)のように与えられる。

... (6)

この上端からの収束角は60度以上が得られ、この反射面6eのNAは0.98となり、従来のDVDにおける50 NA=0.6の1.6倍以上に大きくなる。

【0033】上記第3の実施の形態に係る光ヘッド1に よれば、NArは、実際には設計余裕を見るため、0. 9程度が限界であるが、赤色レーザ(波長630nm) と青色レーザ(400nm)を用いた場合、それぞれ光 スポット径として $0.19\mu m$ 、 $0.12\mu m$ まで絞る ことができ、スリット7aから滲み出す近接場10の光 量すなわち光利用効率は第1の実施の形態に比べて約2 0%程度増加することができる。また、反射型の集光の ため、色収差が生じない。また、本実施の形態の光学系 は、いわゆる無限系、すなわちコリメータレンズ3と透 10 明集光用媒体6の入射面6aとの間のレーザビーム2b は平行となっているため、温度変動に対する焦点位置ず れが小さい。

【0034】図7は、本発明の第4の実施の形態に係る 光ヘッドの主要部を示す。この光ヘッド1は、平面状の 反射面6eを有する透明集光用媒体6を用い、反射面6 e の表面に反射膜11として反射型ホログラムを用いた ものであり、他は第3の実施の形態と同様に構成されて いる。反射型ホログラムとしては、凹凸型のバイナリホ ログラムでも有機感光材料からなるボリュームホログラ 20 ムでもよい。また、これらのホログラムの外側にアルミ ニウム等の高反射金属層からなる反射謨を被着してもよ い。透明集光用媒体6の反射面6eを平面状とすること により、第3の実施の形態と比較して生産性を上げるこ とができる。スリット7aは、第3の実施の形態と同様 に、長手方向がトラック方向Xに直交する方向Yとなる ように形成される。

【0035】図8(a), (b) は、本発明の第5の実施の 形態に係る光ヘッドの主要部を示す。この光ヘッド1 は、同図(a) に示すように、透明集光用媒体6にSIM 30 (Solid Immersion Mirror)型 と称せられているものを用いたものであり、レーザビー ム2aを出射する半導体レーザ2と、半導体レーザ2か らのレーザビーム2aを平行ビーム2bに整形するコリ メータレンズ3と、コリメータレンズ3からの平行ビー ム2bを垂直方向に反射するミラー4と、ミラー4から の平行ビーム2 b が入射する凹球面状の入射面6 a、入 射面 6 a に対向する位置に設けられた集光面 6 b、およ び入射面6 a の周囲に形成された非球面状の反射面6 e を有する透明集光用媒体6と、透明集光用媒体6の反射 40 面6eの表面に被着形成された反射膜11と、透明集光 用媒体6の集光面6 bの表面に非着形成され、スリット 7 aを有する遮光膜7とを有する。スリット7 aは、同 図(b) に示すように、第1の実施の形態と同様に、光ス ポット9に対応する位置に長手方向がトラック方向Xに 直交する方向Yとなるように形成されている。

【0036】次に、第5の実施の形態に係る光ヘッド1 の動作を説明する。半導体レーザ2からレーザビーム2 aを出射すると、そのレーザビーム2aはコリメータレ ンズ3によって整形され、ミラー4で反射された後、透 50 って光ヘッド1を支持している。

明集光用媒体6の入射面6 aに入射する。入射面6 aに 入射した平行ビーム2bは、入射面6aで拡散され、そ の拡散光2 d は、遮光膜7で反射し、その反射光2 e は、反射膜11で反射して集光面6bに集光し、集光面 6 bに光スポット9が形成され、スリット7 aから近接 場光10が滲み出す。スリット7aから滲み出した近接 場光10は、記録媒体8の記録層8a中に入射し、この 光によって記録層8aへの記録および読み出しが可能に

【0037】上記第5の実施の形態に係る光ヘッド1に よれば、第1の実施の形態と同様に、トラック方向Xの 記録密度を増大させることができるとともに、第1の実 施の形態で用いた対物レンズが不要であるので、構成の 簡素化が図れる。また、透明集光用媒体6が膨張あるい は収縮しても集光点が変化しないので、温度変化にも対 応できる。なお、遮光膜7は、図4(a), (b) に示す構 造にしてもよい。なお、光スポットの径は、上記したよ うに 0.2μ m程度以下であり、効率よく 0.1μ m以 下のスリットに光を入射するためには、光スポットとス リットの位置合わせは、少なくとも0. 1μm以下の誤 差で合わせる必要がある。第1、第2の実施の形態で示 したようなSILを用いた集光では、対物レンズを用い て集光を行い、その収束光をSILに入射するため、入 射光と対物レンズおよびSIL相対位置によって光スポ ットの位置が変動するので、上記三者の位置を高精度に 合わせなければならない。一方、第3乃至第5の実施形 態で示した光ヘッドにおいて、集光のための対物レンズ を用いず、かつ、平行光ビームを本実施例の透明集光用 媒体に直接入射させることにより、平行光ビームと透明 集光用媒体の相対位置がずれても、光スポットの位置が 変動しないようにできる。そのため、それぞれの位置合 わせ精度が大幅に緩和でき、製作上非常に有利である。 【0038】図9(a) は、本発明の第1の実施の形態に 係る光ディスク装置を示し、同図(b) は、同図(a) のA -A断面図である。この光ディスク装置100は、円盤 状のプラスチック板120の一方の面にGeSbTeの 相変化材料からなる記録層121が形成され、図示しな いモータによって回転軸30を介して回転する光ディス ク12と、光ディスク12の記録層121に対し光記録 /光再生を行う光ヘッド1と、光ヘッド1をトラッキン グ方向31に移動させるリニアモータ32と、リニアモ . ータ32側から光ヘッドを支持するサスペンション33 と、光ヘッド1を駆動する光ヘッド駆動系34と、光ヘ ッド1から得られた信号を処理するとともに、光ヘッド 駆動系34を制御する信号処理系35とを有する。

【0039】リニアモータ32は、トラッキング方向3 1に沿って設けられた一対の固定部32 aと、一対の固 定部32a上を移動する可動コイル32bとを備える。 この可動コイル32bから上記サスペンション33によ

【0040】図10は、光ディスク12の詳細を示す。 この光ディスク12は、光ヘッド1によって形成される 近接場光10の微小化に対応して高記録密度化を図った ものである。プラスチック板120は、例えば、ポリカ ーボネート基板等が用いられ、その一方の面にグルーブ 部12 aが形成される。この光ディスク12は、プラス チック板120のグルーブ部12aが形成された側の面 に、A1反射膜層(100nm厚)121a、SiO 層(100nm厚) 121b、GeSbTe記録層(1 5 nm厚) 121c、SiN層(50nm厚) 121d を積層して記録層121を形成したものである。本実施 の形態では、ランド部12bに情報が記録してあり、ト ラックのピッチは0.12μm、グループ部12aの深 さは約0.06 μ mとしている。マーク長は0.05 μ m、記録密度は110Gbits/inch'であり、 12 c mディスクでは180 G B の記録容量に相当し、 従来のDVDの40倍に高記録密度化できる。なお、光 記録媒体としては、凹凸ピットを有する再生専用ディス クや光磁気記録材料や相変化材料を用いた記録・再生用 媒体、色素などの光吸収により凹凸ピットを形成して記 録を行う追記型媒体等の各種の記録媒体を用いることが できる。

【0041】図11は、第6の実施の形態に係る光ディ スク装置100の光ヘッド1を示し、同図(a) はその縦 断面図、同図(b) はその横断面図である。光ヘッド1 は、光ディスク12上を浮上する浮上スライダ36を有 し、この浮上スライダ36上に、例えば、A1Galn Pからなり、波長630nmのレーザビーム2aを出射 する端面発光型の半導体レーザ2と、半導体レーザ2か ら出射されたレーザビーム2 a を平行ビーム2 b に整形 するコリメータレンズ3と、浮上スライダ36上に取り 付けられた溶融石英板からなるホルダ37Aと、半導体 レーザ2およびコリメータレンズ3をホルダ37A上に 固定する溶融石英板からなるホルダ37Bと、半導体レ ーザ2を圧電素子41を介して支持するホルダ37C と、半導体レーザ2からの平行ビーム2bと光ディスク 12からの反射光とを分離する偏光ビームスプリッタ1 3と、半導体レーザ2からの平行ビーム2bの直線偏光 を円偏光にする 1 / 4 波長板 3 8 と、平行ビーム 2 b を 垂直方向に反射するミラー4と、ミラー4で反射した平 行ビーム2bを収束させる対物レンズ5および上部透明 集光用媒体 6 'と、ホルダ37Aに取り付けられ、光デ ィスク12からの反射光をビームスプリッタ13を介し て入力する光検出器 1 5 とを各々配置している。また、 全体はヘッドケース39内に収納され、ヘッドケース3 9は、サスペンション33の先端に固定されている。

【0042】上部透明集光用媒体6'は、例えば、屈折率n=1. 91を有する重フリントガラスからなり、直径1mm、高さ約1. 3mmを有し、図1に示す透明集光用媒体6と同様に、Super SIL構造である

が、浮上スライダ36を上部透明集光用媒体6'とほぼ 等しい屈折率を有する透明媒体36から構成し、浮上ス ライダ36の集光面36aに光スポット9が形成され る。即ち、上部透明集光用媒体6′と浮上スライダ36 とで一体の透明集光用場体を構成する。浮上スライダ3 6の集光面36aには、図1に示したのと同様に、スリ ット7aを有する遮光膜7が被着形成されている。スリ ット7aは、同図(b) に示すように、長手方向がトラッ ク方向Xに直交する方向Yとなるように形成される。 【0043】浮上スライダ36は、図11(b) に示すよ うに、集光面36aに形成される光スポット9の周辺部 以外の部分に負圧を生じるように溝36bを形成してい る。この溝36bによる負圧とサスペンション33のば ね力との作用によって浮上スライダ36と光ディスク1 2との間隔が、浮上量として一定に保たれる。本実施の 形態では、浮上量は約0.06 µmである。なお、下面 36 cが摺動面となる。また、浮上スライダ36の浮上 量は0. 1μm以下と極めて小さく、先端が集光面とな る凸部の先端と光ディスクとの間隔も精度よく設定する 必要がある。ここで図示するように、先端が集光面6 b となる凸部6 f の先端と浮上スライダ36の下面36 c が同一平面上にあるようにすることにより、浮上スライ ダ36の浮上量をコントロールすることで凸部の先端と 光ディスク12との間隔も精密に調整でき、また凸部6 f が光ディスク12に衝突し、摩耗することもない。 【0044】光ベッド駆動系34は、記録時に、半導体 レーザ2の出力光を記録信号により変調することによ り、記録層121に結晶/アモルファス間の相変化を生 じさせ、その間の反射率の違いとして記録し、再生時に は、半導体レーザ2の出力光を変調せずに、連続して照 射し、記録層121での上記の反射率の違いを反射光の

【0045】信号処理系35は、光検出器15が検出し た光ディスク12からの反射光に基づいてトラッキング 制御用の誤差信号およびデータ信号を生成し、誤差信号 をハイパスフィルタとローパスフィルタによって高周波 域の誤差信号と低周波域の誤差信号を形成し、これらの 誤差信号に基づいて光ヘッド駆動系34に対しトラッキ ング制御を行うものである。ここでは、トラッキング用 の誤差信号をサンプルサーボ方式(光ディスク技術、ラ ジオ技術社、P. 95) によって生成するようになって おり、このサンプルサーボ方式は、干鳥マーク(Wob bled Track)を間欠的にトラック上に設け、 それからの反射強度の変動から誤差信号を生成する方式 である。サンプルサーボ方式の場合、記録信号とトラッ キング誤差信号とは時分割的に分離されているので、両 者の分離は再生回路におけるゲート回路によって行う。 また、サンプルサーボ方式を用いる場合には、受光面が 1つの光検出器を用いることになるので、反射光による

変動として光検出器15により検出するようになってい

半導体レーザの変調を用いて信号再生を行うSCOOP 方式と組み合わせるのに好適である。なお、グループ部 12aからの反射光との干渉を利用するプッシュプル方 式で誤差信号を生成してもよい。

【0046】図12は、圧電素子41を示す。圧電素子41は、一対の電極端子410, 410に接続された複数の電極膜411と、電極膜411間に形成された多層 P2Т薄膜(厚さ約 20μ m)412とからなる。この圧電素子41は、上記ホルダ37Cに被着形成されており、この圧電素子41により集光用透明媒体6を支える 10とともに、トラック方向Xに直交する方向Y(トラッキング方向31)に走査する。

【0047】次に、上記第6の実施の形態に係る光ディ スク装置100の動作を説明する。光ディスク12は、 図示しないモータによって所定の回転速度で回転し、浮 上スライダ36は、光ディスク12の回転によって発生 する負圧とサスペンション33のばね力との作用によっ て光ディスク12上を浮上走行する。光ヘッド駆動系3 5による駆動によって半導体レーザ2からレーザビーム 2 aが出射されると、半導体レーザ2からのレーザビー 20 ム2 a は、コリメータレンズ3 により平行ビーム2 b に 整形された後、偏光ビームスプリッタ13および1/4 波長板38を通り、上部透明集光用媒体6~の入射面 6'aに入射する。平行ビーム2bは、1/4波長板38 を通過する際に、1/4波長板38によって直線偏光か ら円偏光に変わる。円偏光の平行ビーム2 bは、対物レ ンズ5に収束され、上部透明集光用媒体6′の入射面 6'aで屈折して集光され、浮上スライダ36の集光面3 6 aに集光する。浮上スライダ36の集光面36 aに微 小の光スポット9が形成される。この光スポット9下の 30 スリット7aから光スポット9の光の一部が近接場光1 0として浮上スライダ36の下面36cの外側に漏れ出 し、この近接場光10が光ディスク12の記録層121 に伝播して光記録あるいは光再生が行われる。光ディス ク12で反射した反射光は、入射光の経路を逆にたど り、上部透明集光用媒体 6 °の入射面 6 °aで屈折してミ ラー4で反射され、1/4波長板38で入射光(2a) と偏光面を90度異にする直線偏光光に成形された後、 偏光ビームスプリッタ13で90度方向に反射され、光 検出器15に入射する。信号処理系35は、光検出器1 5に入射した光ディスク12からの反射光に基づいてト ラッキング制御用の誤差信号およびデータ信号を生成 し、誤差信号に基づいて光ヘッド駆動系34に対しトラ ッキング制御を行う。

【0048】上記第6の実施の形態に係る光ディスク装置100によれば、上部透明集光用媒体6'の入射面6'aでの最大屈折角が60度となり、NAは0.86が得られ、この結果、スポット径D_{1/1}約0.2μmの微小の光スポット10が得られ、その約20%を幅50nmのスリット7aを通して近接場光10として光ディ50

スク12の記録層121に入射でき、超高密度(110 Gbits/inch¹)の超髙密度の光記録/光再生 が可能になる。また、自動焦点制御を行わずに記録再生 ができるため、自動焦点制御機構が不要となり、光ヘッ ド1の重量を大幅に減らすことができ、小型化が図れ た。すなわち、光ヘッド1のサイズは、高さ6mm、幅 4mm、長さ8mm、重量は0.6gと軽量となった。 このため、リニアモータ33の可動コイル33Bとサス ペンション34を含めて可動部の重量を2.0g以下に できた。この結果、リニアモータ32のみで帯域50k Hz以上、利得60以上が得られた。従って、600r pmの回転下においてトラッキング可能であり、平均転 送レートは60Mbpsが得られる。また、サンプルサ ーボ方式の採用により、記録信号とトラッキング誤差信 号とは時分割的に分離されているので、光検出器15と しては、分割型のものは必要なく、例えば、1mm角の PINフォトダイオードを用いることができる。光検出 器15として分割型である必要がないため、検出系を大 幅に簡素・軽量化できる。 また、透明集光用媒体6の 重量は、5mg以下と軽いため、透明集光用媒体6を支 持する系の共振周波数を300kHz以上にでき、電極 端子410, 410間への印加電圧5Vで0. 5 μm以 上の変位が得られる。また、この圧電素子41とリニア モータ32による2段制御により、80dBの利得で3 00kHzの帯域が得られ、高速回転時(3600rp m) 下において5nmの精度でトラッキングを行うこと ができる。これにより、本実施の形態では転送レートを 圧電素子41を用いない場合の光ディスク装置100の 6倍、すなわち、360Mbpsに上げることができ る。また、後述するマルチビームの光ヘッドを使用した 場合には、さらに8倍となり、500Mbps近くの転 送レートが得られる。また、12cmのディスクにおい て10ms以下の平均シーク速度を達成する。これによ り、3600rpm回転時のアクセス時間は20ms以 下となる。

【0049】なお、トラッキング制御用の誤差信号の生成には、上記実施の形態では、サンプルサーボ方式を用いたが、周囲的に記録トラックを蛇行させて、それによる反射光の変調を蛇行周波数に同期させて検出し、誤差信号を生成するウォブルドトラック方式を用いても、とりで行われているように3スポット方式を用いることも可能である。すなわち、コリメータレンズ3と偏光ビームスプリッタ13の間に回折格子を挿入し、かっ、そのセスプリッタ13の間に回折格子を挿入し、かっ、そのセス光ぞれでがイスクからの反射光を検出する光として次光それぞれのディスクからの反射光を検出する光検出素子を主ビーム検出用素子の両側に配置し、その出力の差分を取ることにより、誤差信号の生成が可能となった。また、記録トラック側面部からの回折光のを力というシスを検出して誤差信号を生成するプッシュプル型の制御を行うことも可能である。この場合はその回折

光を2分割型の光検出素子に入射し、その差動出力誤差 信号を生成する。また、本実施の形態の光ヘッド1をそ のまま追記型光ディスク(色素の光吸収により凹凸ビッ トを形成したディスク) への記録および再生に用いるこ とができる。また、浮上スライダ36の下面36aの光 スポット9が形成される位置の周辺に薄膜コイルを装着 し、磁界変調を行うことにより、光磁気媒体を用いての 光磁気記録も可能となる。但し、再生の場合には、光の 偏波面の回転を偏光解析によって検出して信号を生成す るため、偏光ビームスプリッタ13を非偏光のスプリッ 夕に変え、光検出素子の手前に検光子を配置する必要が ある。また、レーザ源として本実施の形態では、端面発 光型レーザを用いたが、面発光型レーザ (VCSEL) を用いることも可能である。面発光型レーザの場合、基 本モード (TEM00) の最大出力は、2mW程度と端 面発光型レーザの1/10以下であるが、本実施の形態 では従来の光ディスク装置で使用されている光スポット 径の数分の1に絞られているため、光密度が1桁以上高 くできることから、面発光型半導体レーザでも記録が可 能となる。また、面発光型半導体レーザの場合、温度に 20 よる波長変動が小さく、色収差補正を不要にできる。ま た、本実施の形態では、光スポットの駆動に圧電素子を 用いたが、これに限るものではなく、後述する図15に 示すような光スポット駆動型の半導体レーザを使用して

【0050】図13は、本発明の第7の実施の形態に係る光ディスク装置を示す。第6の実施の形態では、シーク動作にリニアモータ32を使用したが、この第7の実施の形態では、ハードディスグに使用する回転型リニアモータ43を使用したものである。光ヘッド1は回動軸 3033aに回動可能に支持されたサスペンション33によって回転型リニアモータ43に接続されている。このような構成とすることにより、回転型リニアモータ43は光ディスク12の外側に配置できるため、光ヘッド1をさらに薄型にでき、光ディスク装置100全体を小型化できる。また、これにより、光ディスク12を高速(3600rpm)に回転することができ、平均360Mbps以上のデータ転送レートが可能になる。

【0051】図14(a) は、本発明の第8の実施の形態に係る光ディスク装置を示し、同図(b) は、光ヘッド1の主要部を示す。この光ディスク装置100は、図13に示す第2の実施の形態において、光ヘッド1から半導体レーザ2、コリメータレンズ3、ホルダ37A、37B、37C、圧電素子41からなるレーザビーム発生系、およびビームスプリッタ13、1/4波長板38、光検出器15からなる光検出系を分離して固定ユニット200内に配置し、光ヘッド1と固定ユニット200とを光ファイバ201で光学的に接続したものである。

【0052】光ヘッド1は、グラファイトで一体型に形成され、光ファイバ201、ミラー4、対物レンズ5、

Super SIL構造の透明集光用媒体6等を支持するとともに、底面202は図11に示すスライダ36の底面と同様に成形され、光ディスク12上を浮上走行するようになっている。

【0053】上記第8の実施の形態に係る光ディスク装 置100によれば、光ファイバー201から集光面6b までの距離が約1mmと短く、この間での熱膨張・収縮 による焦点ずれは少なく、かつ、スリット幅により近接 場光のトラック方向の幅が一定とされてい定とされてい るため、温度変動の影響が少ないため、自動焦点制御を 省くことができる。また、第7の実施の形態の光ヘッド 1からレーザビーム発生系および光検出系を分離したの で、光ヘッド1のサイズは、高さ1.5mm、長さ/幅 2mmとなり、重量は約10mgとなった。このような 超軽量・薄型の光ヘッド1を用いることにより、回転型 リニアモータ43による高速のトラッキングが可能とな り、高転送レート、小型の光ディスク装置を提供でき る。また、この光ディスク装置を後述する図15の光デ ィスク装置と同様のスタック型として、大容量の光ディ スク装置を提供することもできる。なお、高速のトラッ キングを行うためには、従来提案されているように、サ スペンション33にピエソ素子(図示せず)を取付け、 それによりサスペンダ33先端部および光ヘッドを駆動 してもよく、また、ピエゾ素子(図示せず)によりミラ ー4を駆動してもよい。

【0054】図15は、本発明の第9の実施の形態に係 る光ディスク装置を示す。この光ディスク装置100 は、図6に示す透明集光用媒体6を用いた光ヘッド1 を、5枚重ねのディスクスタック型の光ディスク装置に 適用したものであり、プラスチック基板120の上下面 に記録層121,121がそれぞれ被着された5枚の光 ディスク12と、各光ディスク12の記録層121上を 浮上走行する10個の光ヘッド1と、回動軸44によっ て光ヘッド1を回動可能に支持するサスペンション33 と、サスペンション33を駆動する回転型リニアモータ 45とを有する。記録層121としては、相変化型の媒 体でも光磁気型の媒体でもよい。回転型リニアモータ'4 5は、サスペンション33が結合された可動片45a と、ヨーク45 bによって連結され、可動片45 aを駆 動する電磁石45c, 45cとからなる。この光ヘッド 1の構造は、基本的には図6に示すものと同様であり、 回転放物面を有する透明集光用媒体6とAlGalnN 系のレーザ(630nm)を使用しており、光スポット 径は 0. 2 μ m である。ディスク径は 1 2 c m、トラッ クピッチとマーク長はそれぞれ0.12μm、0.05 μmであり、片面の容量は175GB、両面では350 GBである。

【0055】図16(a),(b)は、この第9の実施の形態に係る半導体レーザを示す。この半導体レーザ46 50は、ビーム走査型半導体であり、基板460を有し、こ

の基板460の上面に上部電極461、下面に下部電極 462、中央に活性層463をそれぞれ形成したもので ある。活性層463の発振狭窄部の主部464aと先端 3464 bの幅はそれぞれ 3μ m、 5μ mであり、長さ はそれぞれ300μm、50μmである。上部電極46 1は、主部電極461aと、左右一対の先端部電極46 1 b, 461 b とからなる。活性層 463 の発振部は発 振狭窄部464a、464bにより狭窄され、先端部電 極461b, 461bに分割して、あるいは交互に電流 を流すことにより、出力光ピームは左右に走査される。 この走査幅は1µm、走査周波数は30MH2まで可能 である。このレーザビーム走査とリニアモータ45によ り2段階制御のトラッキングを行った。また、トラッキ ング制御用の誤差信号の生成は、レーザビームのウォブ リング法により行った。すなわち、レーザビームを高速 (10MHz) に0.03μm左右走査することによ り、記録面上での光スポットはコリメータレンズ3と透 明集光用媒体 6 のNA比に比例して約 0. 0 1 μ m ウォ ブリングされる。これにより、記録トラックからの反射 信号が変調され、その変調信号を走査周波数に同期して 20 検波することにより、誤差信号が生成される。

【0056】上記第9の実施の形態に係る光ディスク装 置100によれば、5枚の光ディスク12に情報を記録 できるので、3.5 TBの大容量化が可能になる。な お、光ヘッド1は、図7、図13に示すものを用いても よい。これにより、光ヘッド1の高さを3m以下にで き、光ディスク装置の高さを小型化でき、体積容量を上 げることができる。

【0057】図17は、本発明の第10の実施の形態に 係る光ディスク装置の主要部を示す。この光ディスク装 30 置100は、独立駆動可能な複数(例えば、8個)のレー ーザ素子を備え、複数のレーザ素子から複数のレーザビ ーム2aを出射する半導体レーザ2と、半導体レーザ2 からのレーザビーム2aを所定の入射ビーム2b'に整 形するコリメータレンズ3と、入射ビーム2b'を所定 の方向に反射させるミラー4と、ミラー4で反射した入 射ビーム2b'を収束させる対物レンズ5と、対物レン ズ5により収束された収束光2 c が入射し、集光面6 bに複数の光スポット9を形成する図1と同様の透明集 光用媒体6と、透明集光用媒体6の集光面6bの表面に 40 被着形成された複数のスリット7 a を有する遮光膜 7 と、円盤状のプラスチック板120の一方の面にGeS bTeの相変化材料からなる記録層121が形成され、 図示しないモータによって回転する光ディスク12と、 光ディスク12で反射した光を入射ビーム2b'と分離 する偏光ビームスプリッタ13と、ビームスプリッタ1 3で分離されたレーザビーム2eを集光レンズ14を介 して入力する8分割の光検出器15とを有する。

【0058】図18は、この第10の実施の形態に係る 半導体レーザ2を示す。半導体レーザ2は、端面発光半 50 導体レーザであり、活性層20a、p型電極20b、n 型電極20cを有する。p型電極20bの間隔d。を例 えば15μmにすることにより、レーザビーム2aの間 隔を 15μ mにしている。

【0059】図19は、遮光膜7を示す。遮光膜7は、 レーザビーム2aの数に対応して8つのスリット7aを 有する。コリメータレンズ3のNAは0.16、透明集 光用媒体6でのNAは0.8、レーザビーム2aの間隔 d, は15μmであるので、集光面6bでの光スポット 9の間隔、すなわち、スリット7aの間隔d 2は $3\mu m$ にしている。スリット7aのアレイ軸方向7bは、各ス リット7aがそれぞれ隣接するトラックの真上に位置す るように、光ディスク12のトラックに対してわずかに 傾けてある。すなわち、それぞれの隣接スリット7aの 記録トラックに対する垂直方向の間隔はトラックピッチ (この場合、 $0.12\mu m$) pに等しくなるように配列 されている。スリット7aのアレイ軸方向7bとトラッ ク(図略)の傾き角は23ミリラジアンであり、この傾 きはレーザアレイではその支持台の傾き、スリットアレ イでは形成時のフォトリソグラフィによる調整で行う。 【0060】次に、上記第10の実施の形態に係る光デ イスク装置100の動作を説明する。半導体レーザ2か ら複数のレーザビーム2aが出射されると、半導体レー ザ2からの複数のレーザビーム2aは、コリメータレン ズ3により所定の入射ビーム2b'に整形された後、偏 光ビームスプリッタ13を通り、ミラー4で反射し、対 物レンズ5によって収束され、透明集光用媒体6の入射 面6aで屈折して集光され、集光面6bに集光する。集 光面6 bに複数の光スポット9が形成される。この複数 の光スポット9下の複数のスリット7aから複数の近接 場光10が透明集光用媒体6の外側に滲み出し、この近 接場光10が光ディスク12の記録層121に伝播して 光記録あるいは光再生が行われる。光ディスク12で反 射した反射光は、入射光の経路を逆にたどり、透明集光 用媒体6の入射面6aで屈折してミラー4で反射され、 偏光ビームスプリッタ13で入射ビーム2b'と分離さ れた後、集光レンズ14により8分割の光検出器15に 集光される。

【0061】上記第10の実施の形態に係る光ディスク 装置100によれば、8個のスリット7aからの8個の 独立に変調可能な近接場光10により、独立に8本の記 録トラックを同時に記録・再生することができ、記録再 生の転送レートを8倍にすることができる。なお、スリ ット7aのアレイの長さは20μm程度であり、その間 のトラックの曲がりば 0.007μ mとトラック幅01/10以下であるので、これによるトラックずれは無視 できる。また、スリット7aの数は必ずしも8個に限る ものではなく、用途により増減可能である。なお、诱明 集光用媒体6は、他の実施の形態に示すものを用いても よい。また、複数のスリットを1つのビームスポットで

照射し、いずれかのスリットから照射された近接場光を用いると、トラッキングの周波数帯域を下げることができる。また、端面発光半導体レーザは、図16に示されるように、活性層20aの積層方向に沿って発光点が形成されるので、半導体レーザの設置する向き、言い換えれば活性層の向きを縦置きするか、横置きするかで照射されるビーム列の方向が変わるので、任意に選択できる。なお、単一の発光点を有する端面発光半導体レーザであっても、ビーム形状や偏光方向が活性層の方向によって異なるため、半導体レーザの設置方向を縦置き、あるいは横置きすることで、所望のビーム形状および偏光方向を選択することができる。

【0062】図20は、本発明の第11の実施の形態に係る光ディスク装置を示す。この光ディスク装置の光へッド1は、遮光膜7の外径のみ図1の光へッド1と異なり、他は同様に構成されている。この遮光膜7は、光スポットの径より若干大きい外直径を有したものである。光ディスク12は、保護膜12h、記録層12i、干渉層12j、反射層12kを備えている。本実施の形態の場合、保護膜12h、記録層12i、干渉層12jおよ 20び反射層12kの全厚さは約100nm、保護膜12h とスリット7aとの距離は、約50nmである。

【0063】次に、上記第11の実施の形態に係る光へッド1の動作を説明する。対物レンズからの収束光2cは、透明集光用媒体6の球面状の入射面6aで屈折し、その屈折光2dは集光面6bに集光する。集光面6bに光スポット9が形成される。遮光膜7のスリット7aから漏れ出す近接場光10は、伝播光となって光ディスク12に入射し、光ディスク12の反射層12kで反射する。反射層12kで反射した反射光2kは、遮光膜7の30スリット7aを通過するだけでなく、遮光膜7の外側も通過して透明集光用媒体6および対物レンズを介して光検出器に入力される。

【0064】スリット7aからの近接場光10の強度分 布は、記録媒体内でスリット7aを完全拡散面と考えた 場合の強度分布1として近似できる。この場合が最も広 がり方が大きく、角度分布は $Cos\theta$ で近似される。こ の光はこの分布を保ちながら、反射膜12kで透明集光 用媒体6の方向に反射される。スリット7aの幅を50 nm、遮光膜7の外径を0.2μmとした場合に、遮光 40 膜7の周辺部の光を取り入れることにより、約1桁の強 度改善が可能となる。また、この効果は、スリット7a のサイズが小さくなる程大きくなる。また、周辺部の光 は透明集光用媒体6の入射面6aで屈折して内部に入 り、スリット7 aからの戻り光は、スリット7 aを中心 として広がるので、両者の指向性は若干異なるが、透明 集光用媒体6の直径は1mm程度とスリット7aや記録 媒体の膜厚(150nm)に比べて十分大きいため、そ れらのずれは無視でき、両者をまとめて光検出器に導入 することは可能であり、反射光の強度の増大を図ること 50 ができる。

【0065】図21は、再生時に符号誤り率1×10⁻⁹ を維持するために必要な検出光パワーと再生速度との関 係を示す。なお、図21において、実線はデュティ比 0.1、破線は1の場合を示し、線群Aは光検出器の量 子効率0.1、線群Bは1の場合を示す。本実施の形態 の検出光パワーは、-30dBm程度であるので、再生 速度を10゜ビット/秒以上にすることができる(大津 元一, エレクトロニクス, 96年5月号, p. 9.2)。 【0066】図22は、本発明の第12の実施の形態に 係る光ディスク装置の光ヘッドを示し、同図(a) はその 縦断面図、同図(b) はその横断面図である。この光ヘッ ド1は、図8に示す光ヘッド1を図9に示す光ディスク 装置100に適用したものである。光ヘッド1は、光デ ィスク12上を浮上する浮上スライダ36を有し、この 浮上スライダ36上に、例えば、AlGalnPからな り、波長630nmのレーザビーム2aを出射する端面 発光型の半導体レーザ2と、半導体レーザ2から出射さ れたレーザビーム2 aを平行ビーム2 bに整形するコリ メータレンズ3と、浮上スライダ36上に取り付けられ た溶融石英板からなるホルダ37Aと、半導体レーザ2 およびコリメータレンズ3をホルダ37A上に固定する 溶融石英板からなるホルダ37Bと、半導体レーザ2を 圧電素子41を介して支持するホルダ37Cと、半導体 レーザ2からの平行ビーム2bと光ディスク12からの 反射光とを分離する偏光ビームスプリッタ13と、半導 体レーザ2からの平行ビーム2bの直線偏光を円偏光に する1/4波長板38と、平行ビーム2bを垂直方向に 反射するミラー4と、ミラー4で反射した平行ビーム2 bを収束させる図8に示す上部透明集光用媒体6"と、 上部透明集光用媒体6"の反射面6eに被着形成された 反射層11と、座板37Aに取り付けられ、光ディスク 12からの反射光をビームスプリッタ13を介して入力 する光検出器15とを各々配置している。また、全体は ヘッドケース39内に収納され、ヘッドケース39は、 サスペンション33の先端に固定されている。浮上スラ イダ36の下面36aには、図8に示したのと同様に、 スリット7aを有する遮光膜7が被着形成されている。 【0067】この第12の実施の形態に係る光ディスク 装置100によれば、浮上スライダ36の下面36aに 形成された光スポット 9 から外部に滲み出す近接場光を スリット7aによって絞っているので、第1の実施の形 態の光ディスク装置100と同様に超高密度の光記録/ 光再生が可能になるとともに、光ヘッド1の高さ方向の 小型化が図れる。なお、この光ヘッド1を図13、図1 4、図15、図17に示す光ディスク装置100に適用 してもよい。なお、本発明の光ヘッドは、レーザや検出 部などの重くなる部分を固定部に置き、可動部には対物 レンズと折り返しミラーなどの軽量素子のみを乗せる、 所謂分離型としてもよい。しかし、前述したように本発

明の光ヘッドにおいては、透明集光用媒体状に形成する 光スポットとスリットとは、0. 1μm以下といった髙 精度の位置合わせを必要とする。このとき、分離型で は、光ディスクの上下動や可動部の動き、温度変化によ るひずみなどのため、可動部と固定部をこのような精度 で合わせるのが、困難な場合がある。したがって、少な くとも発光素子と透明集光用媒体とを同じ筐体中に設置 して一体とすることが好ましい。こうすることで、変 動、ひずみによる光スポットとスリットの位置ずれを防 止することが可能となる。ディスクに記録された情報を 10 読み出す方式は、実施例に記載したような反射光を検出 する方式に限らず、公知のOAM(Optically Assisted Magnetic) 記録方式のように磁気記録に光を利用する方 式などに対しても本発明は当然適用できる。また、上述 の実施の形態においては、コリメートレンズ、反射鏡、 対物レンズ、上部透明集光用媒体といった光学機能を1 個の光学要素で構成しているが、複数の光学要素を組み 合わせて機能させてもよく、少なくとも、透明集光用媒 体の表面上に集光による光スポットが形成され、その位 置にスリットが位置するように遮光膜を設ければよい。 上述の実施の形態ではスリットとディスクの記録トラッ クとを直交させたが、トラックに対して傾斜していても よい。この場合、ディスクの記録特性によっては記録ピ ットの安定性が向上したり、反射光強度変化や磁化量が 向上し読み出し特性が向上する場合がある。さらに反射 体用いて透明集光用媒体上にスポットを形成する場合に は、反射体と透明集光用媒体とに間隙が存在しても良い が、収差を発生させないためには、反射体と透明集光用 媒体が密着している方が好ましい。また、反射体とし て、反射膜のみを示したが、金属で成型したものを用い 30 てよい。ただし、透明集光用媒体との密着性を考える と、反射膜の方が好ましい。また、遮光体も上述の形態 では遮光膜のみを示したが、スリットから近接場が漏れ 出せばよいのであって、別途シートで形成したり、化学 的に処理してスリットの周囲を実質的に遮光するように しても良い。ただし、膜厚を薄くできる点、スリットの 形成精度の面から、遮光膜を用いた方が好ましい。

[0068]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 集光面に形成せれた光スポットから透明集光用媒体の外 40 部に滲み出す近接場光を記録トラックに直交する方向の スリットによって絞っているので、光ディスク上に形成 される近接場光スポットのトラック方向の微小化が図れ る。この結果、光ディスクの高記録密度化が可能になる また、そのスポット位置にスリットを位置させて、ここ から近接場光を得るようにしたため、高い光利用効率が 得られる。このため、小型・軽量の光源および光検出器 を用いることが可能になるため、光ヘッドおよび光ディ スク装置の小型化が図れ、データ転送レートの向上が図 れる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る光ヘッドの主要部を示す図である。

【図2】(a) は第1の実施の形態に係る透明集光用媒体 および遮光膜を示す図、(b) はその底面図である。

【図3】(a) ~(a) は第1の実施の形態に係る遮光膜の形成方法を示す図である。

【図4】(a),(b) は第1の実施の形態に係る遮光膜の変形例を示す図である。

【図5】本発明の第2の実施の形態に係る光ヘッドの主要部を示す図である。

【図6】(a) は本発明の第3の実施の形態に係る光ヘッドの主要部を示す図、(b) はその底面図である。

【図7】本発明の第4の実施の形態に係る光ヘッドの主要部を示す図である。

【図8】(a) は本発明の第5の実施の形態に係る光ヘッドの主要部を示す図、(b) はその遮光膜を示す図である。

【図9】(a) は本発明の第6の実施の形態に係る光ディスク装置を示す図、(b) は(a)のA-A断面図である。

【図10】第6の実施の形態に係る光ディスクの詳細を示す断面図である。

【図11】(a) は第6の実施の形態に係る光ヘッドの縦 断面図、(b) は横断面図である。

【図12】第6の実施の形態に係る圧電素子の断面図である。

【図13】本発明の第7の実施の形態に係る光ディスク 装置の斜視図である。

【図14】(a) は本発明の第8の実施の形態に係る光ディスク装置の斜視図、(b) は光ヘッドの断面図である。

【図15】本発明の第9の実施の形態に係る光ディスク 装置の断面図である。

【図16】(a), (b) は第9の実施の形態に係る半導体レーザを示す図である。

【図17】本発明の第10の実施の形態に係る光ディスク装置の主要部を示す図である。

【図18】第10の実施の形態に係る半導体レーザを示す図である。

【図19】第10の実施の形態に係る遮光膜を示す図である。

【図20】本発明の第11の実施の形態に係る光ディスク装置の光ヘッドの主要部を示す図である。

【図21】検出光パワーと再生速度との関係を示す図で ある

【図22】(a) は本発明の第7の実施の形態に係る光ディスク装置の光ヘッドの縦断面図、(b) は横断面図である。

【図23】(a) は従来の光ディスク装置を示す図、(b) はその再生時の動作を示す図である。

0 【図24】従来の他の光ディスク装置の光ヘッドを示す

図である。

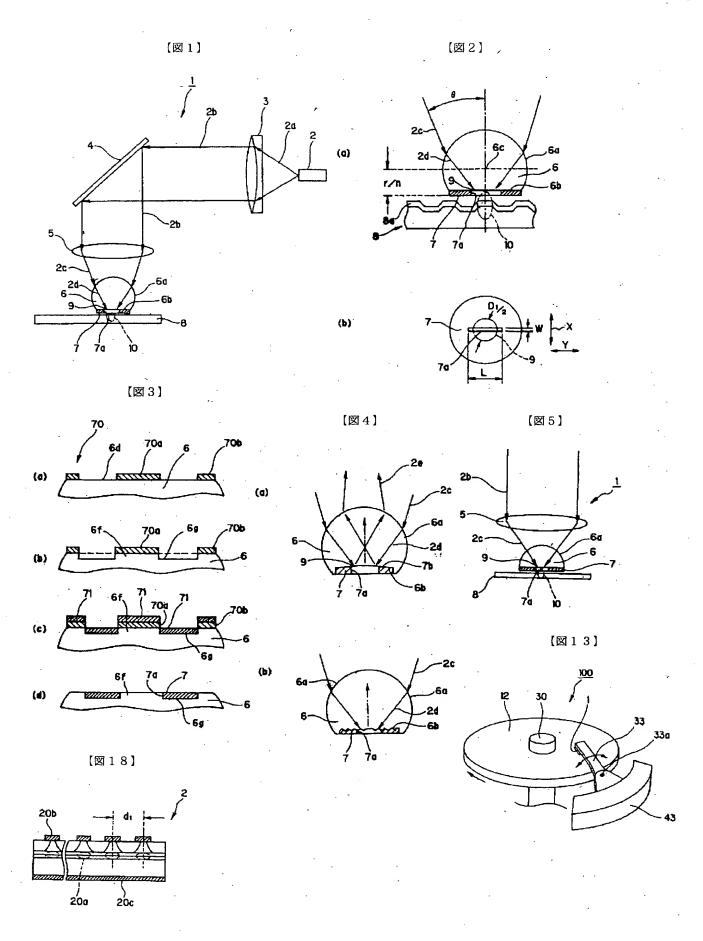
【図 2 5 】図 2 4 における屈折率 n と N A の関係を示す図である。

【図26】従来の光ヘッドを示す図である。

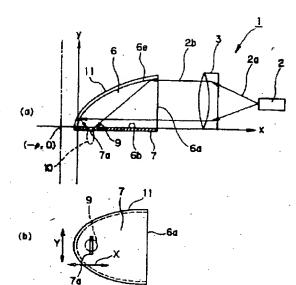
- 【符号の説明】

- 1 光ヘッド
- 2 半導体レーザ
- 2 a レーザビーム
- 2 b 平行ビーム
 - 2 b' 入射ビーム
 - 2 c, 2 c' 収束光
- 2 d 拡散光
- 2 e 反射光
- 3 コリメータレンズ
- 4 ミラー
- 5 対物レンズ
- 6 透明集光用媒体
- 6', 6" 上部透明集光用媒体
- 6 a, 6 a 入射面
- 6 b 集光面
- 6 c 中心
- 6e 反射面
- 6 d 底面
- 7 遮光膜
- 7 a スリット
- 8 記録媒体
- 8 a 記録層
- 9 光スポット
- 10 近接場光
- 11 反射膜
- 12 光ディスク
- 12a グループ部
- 12b ランド部
- 12h 保護膜
- 12 i 記録層
- 12j 干渉層
- 12k 反射層
- 13 偏光ビームスプリッタ
- 14 集光レンズ
- 15 光検出器
- 20a 活性層
- 20b p型電極
- 20c n型電極
- 30 回転軸
- 31 トラッキング方向
- 32 リニアモータ .
- 3 2 a 固定部
- 32b 可動コイル
- 33 サスペンション
- 33a 回動軸

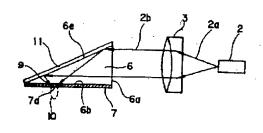
- 34 光ヘッド駆動系
- 35 信号処理系
 - 36 浮上スライダ
 - 36a 集光面
 - 36b 溝
 - 36c 下面
- 37A, 37B, 37C ホルダ
- 38 1/4波長板
- 39 ヘッドケース
- 10 41 圧電素子
 - 42 ホルダ
 - 43, 45 回転型リニアモータ
 - 4 4 回動軸
 - 45a 可動片
 - 4.5 b ヨーク
 - 45c 電磁石
 - 46 半導体レーザ
- 70 フォトレジスト膜
 - 70a フォトレジスト膜のスリットに対応する部分
- 20 70b フォトレジスト膜の遮光膜の周囲に対応する保 護用の部分
 - 71 Ti膜
 - 100 光ディスク装置
 - 120 プラスチック板
 - 121 記録層
 - 121a A1反射膜層
 - 121b SiO₂ 層
 - 125c GeSbTe記錄層
 - 121d SiN層
- 30 200 固定ユニット
 - 201 光ファイバ
 - 202 底面
 - 410 電極端子
 - 4 1 1 電極膜
 - 412 多層PZT薄膜
 - 460 基板
 - 461 上部電極
 - 461a 主部電極
 - 46fb 先端部電極
- 40 462 下部電極
 - 4 6.3 活性層
 - 464a 発振狭窄部の主部
 - 4 6 4 b 発振狭窄部の先端部
 - d_しレーザビームの間隔
 - d: スリットの間隔
 - p トラックピッチ
 - X トラック方向
 - Y トタック方向に直交する方向
 - θ 入射角



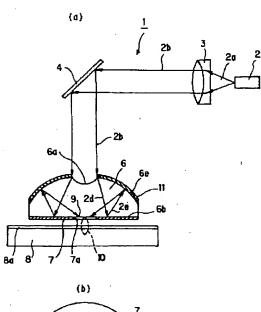
[図6]



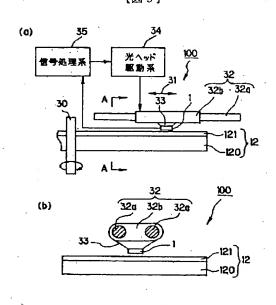
[図7]



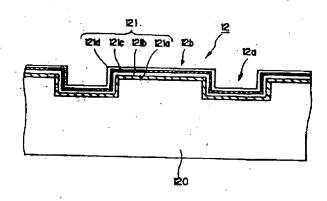
[図8]

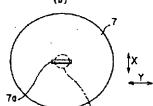






【図10】





(a)

(a)

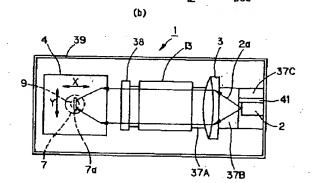
2a 2

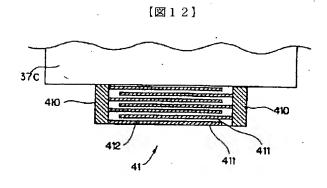
41

5

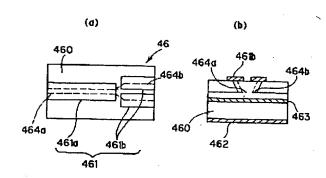
6a

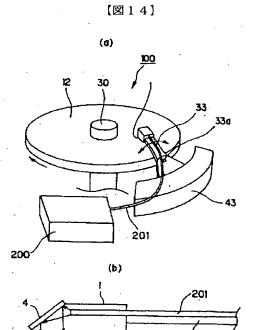
6a



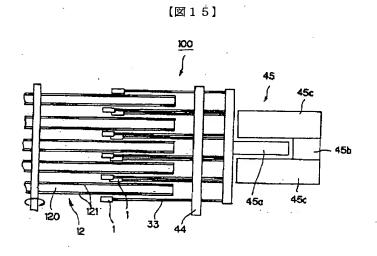


【図16】

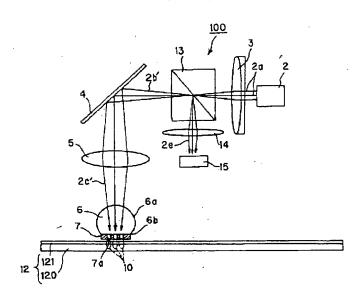




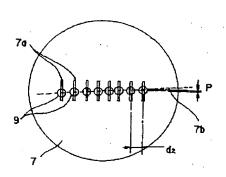
202



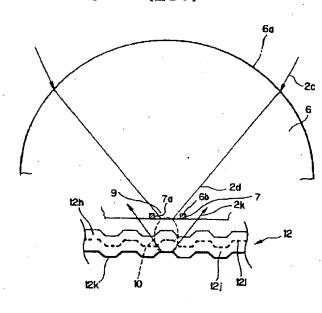
[図17]



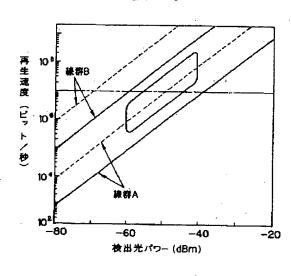
【図19】



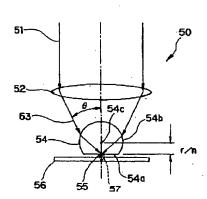
[図20]



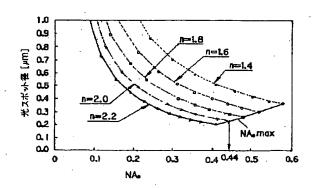
【図21】



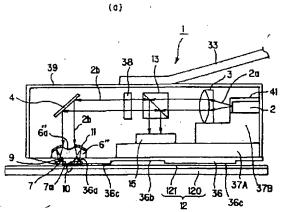
【図24】

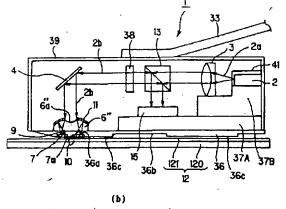


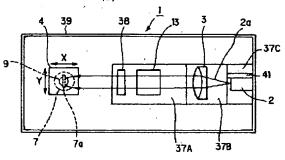
【図25】



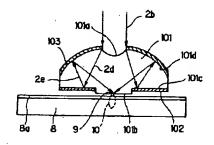
【図22]



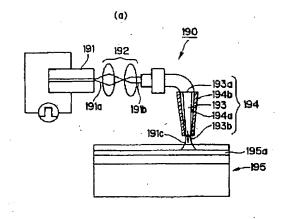


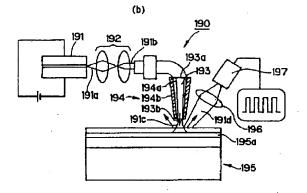


【図26】



【図23】





フロントページの続き

(51) Int. C1.7

識別記号

F I

G 1 1 B 7/22 テーマコード(参考)

G 1 1 B 7/22

Fターム(参考) 2H087 KA13 LA01 LA21 LA25 PA01

PA03 PA17 PA18 PB01 PB02

PB04 QA01 QA02 QA05 QA07

QA18 QA21 QA25 QA34 QA42

QA45 RA31 RA46 TA01 TA03

TA06 UA02

5D119 AA22 AA38 BA01 CA06 EB04

FA05 FA08 FA17 FA21 JA36

JA44 JA48 JA57 JA59 JB03

LB06 MA06